

где  $R = (1 - v^2/c^2)^{-1} + (\tau/m_0) (\partial f / \partial V)$  — аналог числа Рейнольдса,  $V$  — скорость ДГ. Как известно, с помощью нелинейной замены переменных (2) сводится к линейному уравнению диффузии, и тем самым можно получить общее решение для  $q$

$$q = Vt + \frac{4c^2\tau}{VR} \ln \left\{ \left( \frac{R}{4\pi c^2 \tau t} \right)^{1/2} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left[ -\frac{R}{4c^2\tau} \left( Vq_0(\xi, t=0) - \frac{(x-\xi)^2}{t} \right) \right] d\xi \right\}. \quad (3)$$

Для параболического начального возмущения ДГ

$$q = b [(L/2)^2 - x^2]^{1/2} \text{ при } -L/2 \leq x \leq L/2; \quad 0 \text{ при } x > L/2, x < -L/2$$

интеграл в (1) сводится к интегралу вероятностей. Расчеты времени релаксации велись при следующих значениях параметров ДГ:  $m_0 = 5 \cdot 10^{-12}$  г/см<sup>2</sup>,  $\mu = 10^4$  см/с·Э,  $A_0 = L/5$ ,  $\Delta H_t = 30$  Э,  $\Delta H_i = 40$  Э.

На рис. 2 представлены теоретические зависимости  $\beta$ ,  $\beta'$  времени релаксации амплитуды нелинейного возмущения от скорости ДГ. При  $V_t < V < 5.1$  км/с,  $V_t < V < 9.2$  км/с устойчивое решение отсутствует. Полученные теоретические зависимости качественно описывают результаты эксперимента. Максимумы времени релаксации соответствуют максимумам  $R$ . Интересен факт отсутствия устойчивых решений при  $V > V_t$  и  $V > V_i$ .

В заключение можно отметить, что наблюдавшиеся явления могут иметь место в реальных приборах функциональной микроэлектроники в процессах движения ДГ при наличии дефектов в образцах или неодномерностей внешнего управляющего магнитного поля.

#### Л и т е р а т у р а

- [1] Четкин М. В., Гадецкий С. Н., Кузьменко А. П., Филатов В. Н. ПТЭ, 1984, № 3, с. 196—199.
- [2] Четкин М. В., Звездин А. К., Гадецкий С. Н. и др. ЖЭТФ, 1988, т. 94, № 1, с. 269—279.
- [3] Звездин А. К., Попков А. Ф. Письма в ЖЭТФ, 1984, т. 39, № 8, с. 348—351.
- [4] Звездин А. К., Костюченко В. В., Попков А. Ф. ФТТ, 1985, т. 27, № 10, с. 2936—2940.

Московский государственный университет  
им М. В. Ломоносова  
Москва

Поступило в Редакцию  
7 июля 1988 г.

УДК 541.53 : 546.7.28.655

Физика твердого тела. том 31, в. 2, 1989

Solid State Physics. vol. 31, N 2, 1989

## ВАЛЕНТИНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕРИЯ В ТЕРНАРНЫХ СИЛИЦИДАХ d-МЕТАЛЛОВ

*E. M. Левин, O. I. Бодак, L. D. Финкельштейн*

В проблеме промежуточной валентности (ПВ) редкоземельных ионов, в частности, церия, входящих в состав сложных интерметаллических соединений, до настоящего времени не выяснена роль различных факторов в формировании параметров этого состояния. Исходя из этого, представляет интерес изучение различных соединений, отличающихся как типом кристаллической структуры, так и качественным и количественным составами.

Особый интерес среди соединений с промежуточной валентностью редкоземельных ионов представляют тернарные соединения  $R_xM_yX_z$ , где  $R =$

=4f-металл, M=d-металл, X=Si, Ge, P, V, Sn. Для силицидов  $R_xM_ySi_z$  установлено существование широко представленных изоструктурных рядов:  $RM_2Si_2$ , RMSi, RMSi<sub>2</sub>, R(M, Si)<sub>2</sub> и др. [1].

Для зависимости объема элементарной ячейки соединений данных составов от порядкового номера редкоземельного иона при R=Ce наблюдаются отклонения в сторону уменьшения, величина которых зависит от конкретного соединения и обусловлена отклонением валентности  $v$  церия от 3+. Этот вывод согласуется с результатами определения  $v$  церия в соединениях CeM<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> [2], CeMSi, CeMSi<sub>2</sub> и Ce(M, Si)<sub>2</sub> с M=Fe, Co, Ni, проведенного с помощью рентгеновской  $L_{III}$ -абсорбционной спектроскопии.

На рис. 1 приведены  $L_{III}$ -спектры в соединениях церия с никелем и кремнием. Результаты расчета  $v$  по данным рентгеновской спектроскопии, ряд структурных характеристик

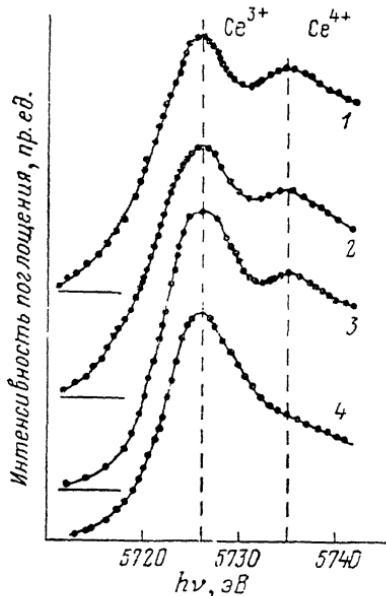


Рис. 1. Рентгеновские  $L_{III}$ -абсорбционные спектры церия:  
1 — CeNi<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>, 2 — CeNiSi, 3 — CeNiSi<sub>2</sub>, 4 — Ce(Ni, Si)<sub>2</sub>.

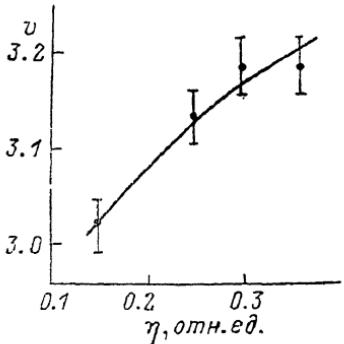


Рис. 2. Зависимость валентности церия в тернарных силицидах системы Ce—Ni—Si от относительного числа  $\eta$  атомов Ni в координационном многограннике Ce.

соединений с никелем, а также с кобальтом и железом, представлены в таблице.

Величина валентности церия в тернарных силицидах изменяется в пределах от  $3.02 \pm 0.03$  до  $3.21 \pm 0.03$ . Это несколько меньше, чем в бинарных соединениях церия с d-металлами; максимальное значение  $v$  в бинарных соединениях достигает 3, 3..3, 4 [3]. Таким образом, присутствие кремния уменьшает валентность церия по сравнению с бинарными соединениями, что уже отмечалось для олова в [4].

Сравнение величин валентности церия с относительным уменьшением объема элементарной ячейки соответствующего соединения по сравнению с ожидаемым для соединения с Ce<sup>3+</sup> (см. таблицу) показывает достаточно низкую эффективность использования рентгено-структурных методов для определения валентности церия в интерметаллических соединениях.

Для выяснения роли содержания никеля и кремния в формировании величины валентности Ce были проанализированы зависимости  $v$  от содержания атомов Ni и Si, в том числе от относительного числа атомов Ni в координационном многограннике церия  $\eta$ . В последнем случае наблюдается хорошая корреляция: при росте  $\eta$  величина  $v$  также увеличивается (рис. 2). Близость  $v$  в CeNi<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> и CeNiSi при различных значениях может быть связана с изменением межатомных расстояний Ce—Ni. В CeNi<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> ближайшее расстояние Ce—Ni составляет 0.312 нм, в CeNiSi — 0.310 нм.

Сравнение значений валентности церия в изоструктурных силицидах, германидах [5] и станнидах CeNi<sub>2</sub>X<sub>2</sub> показывает, что рост размеров атома

Структурные характеристики тернарных соединений *d*-металлов и валентность церия

Соединение	Структурный тип	Число атомов в элементарной ячейке	Относительное уменьшение объема элементарной ячейки на 1 ат. Ce, %	Валентность Ce ( $\pm 0.03$ )	Относительное число атомов <i>d</i> -металла в координационном многограннике Ce ( $\eta$ )
Ce(Fe, Si) <sub>2</sub>	AlB <sub>2</sub>	3	2.9	3.06	0.15
Ce(Co, Si) <sub>2</sub>			3.4	3.08	0.15
Ce(Ni, Si) <sub>2</sub>			0	3.02	0.15
CeFeSi <sub>2</sub>	CeNiSi <sub>2</sub>	16	—	3.10	0.25
CeCoSi <sub>2</sub>			—	3.18	0.25
CeNiSi <sub>2</sub>			1	3.13	0.25
CeFeSi	PbFCI	12	1	3.17	0.22
CeCoSi			0	3.16	0.22
CeNiSi	$\alpha$ -ThSi <sub>2</sub>	12	—	3.18	0.3
CeFe <sub>2</sub> Si <sub>2</sub>	CeGa <sub>2</sub> Al <sub>2</sub>	10	4.3	3.21	0.36
CeCo <sub>2</sub> Si <sub>2</sub>			2.8	3.15	0.36
CeNi <sub>2</sub> Si <sub>2</sub>			3.1	3.18	0.36
CeNi <sub>2</sub> Ge <sub>2</sub>	CaBe <sub>2</sub> Ge <sub>2</sub>	10	—	3.20 [5] 3.07 [3]	0.36
CeNi <sub>2</sub> Sn <sub>2</sub>			0.3	3.00 [4]	0.41 [4]

П р и м е ч а н и е. Прочерк — не определялось.

металлоида в ряду  $X=Si \rightarrow Ge \rightarrow Sn$  (что в свою очередь является причиной роста расстояния Ce—Ni) также приводит к падению  $v$ .

Качественно такая же корреляция наблюдается и для тернарных силицидов с  $M=Fe, Co$ : при росте  $\eta$  тенденция увеличения  $v$  церия сохраняется. При этом следует отметить, что характер изменения  $v$  церия при фиксированном замещении  $M=Fe \rightarrow Co \rightarrow Ni$  для всех представленных в таблице изоструктурных соединений не адекватен и, очевидно, зависит от симметрии ближайшего к Ce окружения.

Увеличение  $v$  церия при росте содержания атомов *d*-металла в тернарных силицидах согласуется с моделью [6], согласно которой  $v \sim \Gamma_f g_m(\varepsilon_f) |V_{df}|$ , где  $\Gamma_f$  — гибридизационная ширина *f*-уровня,  $|V_{df}|$  — матричный элемент *d*—*f*-гибридизации,  $g_m(\varepsilon_f)$  — плотность электронных состояний вблизи уровня Ферми, задаваемая, в основном, атомами *d*-металла.

Таким образом, значение валентности церия в тернарных силицидах, также как и в станидах, возрастает при увеличении содержания атомов *d*-металла, что можно связывать с ростом плотности электронных состояний металлической матрицы.

#### Л и т е р а т у р а

- [1] Гладышевский Е. И., Бодак О. И. Кристаллохимия интерметаллических соединений редкоземельных металлов. Львов: Выща школа, 1982. 252 с.
- [2] Левин Е. М., Луцив Р. В., Финкельштейн Л. Д., Самсонова И. Д., Ясницкий Р. П. ФТТ, 1981, т. 23, № 8, с. 2401—2405.
- [3] Шабуров В. А., Смирнов Ю. П., Советников А. Е., Тюнис А. В. Письма в ЖЭТФ, 1985, т. 41, № 5, с. 213—215.
- [4] Самсонова И. Д., Сколоздра Р. В., Финкельштейн Л. Д., Комаровская Л. ФТТ, 1985, т. 27, № 7, с. 2203—2205.
- [5] Wohleben D., Röhler J. J. Appl. Phys., 1984, vol. 55, N 6, p. 1904—1909.
- [6] Sales B. S., Viswanathan R. J. Low Temp. Phys., 1976, vol. 23, N 3/4, p. 449—467.

Львовский государственный  
университет им. И. Франко  
Львов

Поступило в Редакцию  
7 июля 1988 г.